

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成30年4月5日(2018.4.5)

【公表番号】特表2017-508702(P2017-508702A)

【公表日】平成29年3月30日(2017.3.30)

【年通号数】公開・登録公報2017-013

【出願番号】特願2016-550836(P2016-550836)

【国際特許分類】

C 03 B 37/01 (2006.01)

C 03 C 8/06 (2006.01)

【F I】

C 03 B 37/01

C 03 C 8/06

【手続補正書】

【提出日】平成30年2月7日(2018.2.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

低融点ガラスフリットまたはファイバを形成する方法において、

低融点ガラスを含むガラス原材料を提供する工程、および

前記ガラス原材料を溶融紡糸して、ガラスファイバを製造する工程、

を有してなり、

前記ガラスファイバのガラス転移温度が、前記ガラス原材料のガラス転移温度の約120%以下である、方法。

【請求項2】

前記低融点ガラスのガラス転移温度が約450℃未満である、請求項1記載の方法。

【請求項3】

前記低融点ガラスが無鉛である、請求項1または2記載の方法。

【請求項4】

前記ガラス原材料が、Tic kガラス組成物および/またはeCapガラス組成物から選択されたりずガラスを含む、請求項1から3いずれか1項記載の方法。

【請求項5】

前記ガラスファイバのストランド厚が約500マイクロメートル未満である、請求項1から3いずれか1項記載の方法。

【請求項6】

前記ガラスファイバをジェットミルに導入して、ガラスフリットを製造する工程をさらに有する、請求項1から5いずれか1項記載の方法。

【請求項7】

前記ジェットミルが、窒素、アルゴン、ヘリウム、クリプトン、および/またはキセノンから選択される不活性ガス雰囲気を含む、請求項6記載の方法。

【請求項8】

前記ガラスフリットの平均粒径が約150マイクロメートル未満である、請求項6または7記載の方法。

【請求項9】

前記ガラスフリットのガラス転移温度が、前記ガラス原材料のガラス転移温度の約120%以下である、請求項6から8いずれか1項記載の方法。

【請求項10】

前記ガラスフリットのガラス転移温度が約250℃未満である、請求項6から9いずれか1項記載の方法。